

2017 年

- 2017-J1(M) マイクロ・ナノバブル水の工学分野への応用
精密工学会誌(公益社団法人精密工学会), 83 巻 7 号(第 991 号), pp.623-626, 2017 年 7 月
白井 泰雪
- 2017-J2(C) ミニマルファブ用新規磁場閉じ込め型 ECR プラズマ源を用いたシリコン窒化膜形成
第 64 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会),
16a-E206-3, 2017 年 3 月
後藤 哲也, 佐藤 恵一朗, 藪田 勇氣, 須川 成利, 原 史朗
- 2017-J3(C) Si イオン注入が IGZO 薄膜へ与える影響
第 64 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会),
16a-502-8, 2017 年 3 月
後藤 哲也, 今泉 文伸, 須川 成利
- 2017-J4(C) ミニマルファブ用ミラー磁場閉じ込めプラズマ源を用いたシリコン窒化膜形成
第 64 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会),
6p-C21-7, 2017 年 9 月
後藤 哲也, 佐藤 恵一朗, 藪田 勇氣, 須川 成利, 原 史朗
- 2017-J5(C) 画素 SF で発生するランダムテレグラフノイズの統計的解析〜トランジスタ形状・時定数・遷移数の影響〜
映像情報メディア学会技術報告, Vol.41, No.32, IST2017-52, pp.13-16, 2017 年 9 月 25 日
黒田 理人, 寺本 章伸, 市野 真也, 間脇 武蔵, 若嶋 駿一, 須川 成利
- 2017-J6(W) 紫外吸光とチャージアンプ回路を用いた高感度・小型リアルタイムガス濃度計
電子情報通信学会技術研究報告, Vol.117, No.260, シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会), SDM2017-56(2017-10), pp.35-38, 2017 年 10 月
石井 秀和, 永瀬 正明, 池田 信一, 志波 良信, 白井 泰雪, 黒田 理人, 須川 成利
- 2017-J7(W) 高精度アレイテスト回路計測技術を用いたソースフォロアトランジスタの動作条件変化によるランダムテレグラフノイズの挙動解析
電子情報通信学会技術研究報告, Vol.117, No.260, シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会), SDM2017-60(2017-10), pp.57-62, 2017 年 10 月
市野 真也, 間脇 武蔵, 寺本 章伸, 黒田 理人, 若嶋 駿一, 須川 成利
- 2017-J8(W) 新規小型ミラー磁場閉じ込めプラズマ源を用いたシリコン窒化膜形成
第 29 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, pp.18-23, 2017 年 11 月
後藤 哲也
- 2017-J9(W) 半導体・電子デバイス製造プロセス用, 高感度・小型リアルタイムガス濃度計に関する研究
第 29 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, pp.24-28, 2017 年 11 月
石井 秀和, 永瀬 正明, 池田 信一, 志波 良信, 白井 泰雪, 黒田 理人, 須川 成利
- 2017-J10(W) プラズマプロセスチャンバで使用される YF3 と YOF の耐腐食性
第 29 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, pp.29-32, 2017 年 11 月
志波 良信, 寺本 章伸, 後藤 哲也, 岸 幸男, 白井 泰雪, 須川 成利